

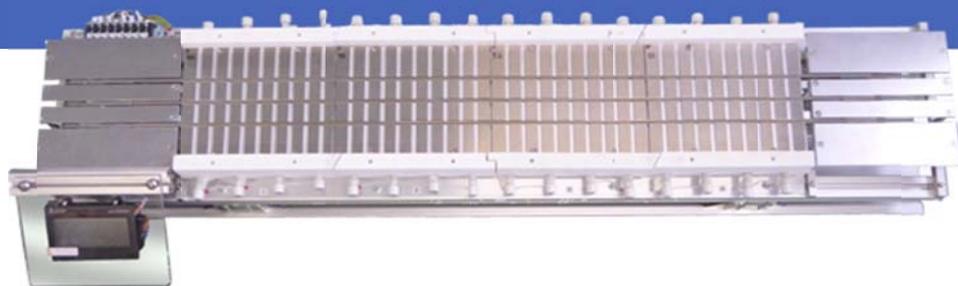
多品種小ロットの乾燥炉 に最適「超小型炉」

省スペースと段取り替えの良さを追求した乾燥炉のご案内

既存の乾燥炉の常識を覆す
新たな発想のもと生み出され
た乾燥炉誕生

ホットプレートの高速加熱を最大限生かす、
搬送システムの追求により、高速搬送とダイレクト加熱を達成。
マルチサイズ対応、高速搬送対応、高速加熱対応、
低フットプリント対応の乾燥炉(実証用)が完成。

WD-100



ホットプレート乾燥炉 WD-100 シリーズ			
対象ワーク	50mm□～125mm□		
乾燥方式	ホットプレート式 乾燥方式		
能力(温度)	PID制御方式 ～200℃ ヒーター 4区分 加熱時間 8秒～10分(max213分) 加熱有効寸法 L800mm×W150mm(200mm×4ch)		
能力(作動)	搬送方法 ウォーキング式3本(接触面利用使用)(上下リフト) 搬送距離 100mm/ピッチ 搬送速度 10mm/s～500mm/s ビーム外幅 88mm/ピッチ 42mm 流方向操作面に向かい左から右、操作パネル タッチパネル 停止時間 タッチパネルより可変可能		
外形寸法	W1200×D200×H165		
質量 消費電力	50kg MAX2.8kw 平常時 500W		

ココが画期的・その1

乾燥が10倍早い

ホットプレートによる高速加熱のメリットを最大限生かす、ウォーキング搬送と組み合わせることで、高速でコンパクト、で自動機との親和性の高い画期的な乾燥炉が完成しました。

炉内加熱基板

IR 雰囲気炉
400 秒

ホットプレート
40 秒

ココが画期的・その2

アイドルタイム 1/20 に低減

炉内で滞留中のワークが減ると、品種切替え時のアイドルタイム低減になり、停電時の廃棄処分減少や、乾燥後検査も可能となります。

またもつともコストのかかる工場の建設費用を抑えます。

炉内加熱基板数

IR 雰囲気炉
190 枚

ホットプレート
10 枚

ココが画期的・その3

溶剤回収でクリーン

独自凝縮機構付(オプション)

- 溶剤回収機構を取付けることで、工場内ダクトをクリーンに。
- 炉内結露防止機構付で、ワークの表面をクリーンに
- メッシュベルトレスで低消費電力

MECH 株式会社
メック

京都市山科区西野山欠ノ上町1-40
TEL075-501-8755 FAX075-501-8756
<http://www.mech.kyoto.jp/>

※本チラシの内容は 2017 年 8 月現在のものです。

私達にお任せください。

代表取締役社長
桐山 直

